



Future Normal in Semiconductor

2025-02-13(목), 15:50-17:20

좌장: 추후업데이트 예정

B. Patterning (Lithography & Etch Technology) 분과

[TL3-B] Etching and Lithography

<p>초청 TL3-B-1 15:50-16:20</p>	<p>Developing Novel Low Global Warming Potential Gases for Etching and Chamber Cleaning Processes Towards Carbon Neutrality Jae-Hyun Noh, Young-Lae Kim, and Byeong-Ok Cho Wonik Materials Co., Ltd., Korea</p>
<p>TL3-B-2 16:20-16:35</p>	<p>수소 플라즈마 환경에서의 CNT 펄리클 life-time 향상을 위한 SiN_x 내화학 피막 연구 강영우^{1,3}, 김하늘^{1,3}, 이인서^{1,3}, 박인성^{2,3}, 안진호^{1,3} ¹한양대학교 신소재공학과, ²한양대학교 나노과학기술연구소, ³Center for Hyperscale, Hyperfunction, Heterogeneous Integration Pioneering Semiconductor Technology</p>
<p>초청 TL3-B-3 16:35-17:05</p>	<p>Sensitivity Evaluation and Nano-Infrared Analysis for EUV Photoresists Jiho Kim, Geonhwa Kim, Nam Hyeon Kim, Boknam Chae, and Sangsul Lee Pohang Accelerator Laboratory, POSTECH</p>
<p>TL3-B-4 17:05-17:20</p>	<p>EUV ptychography microscope를 이용한 마스크 패턴의 고신뢰성 actinic 검사를 위한 EUV ptychography imaging 연구 홍준호^{1,3}, 문승찬^{2,3}, 안진호^{1,2,3} ¹한양대학교 신소재공학과, ²한양대학교 나노반도체공학과, ³Center for Hyperscale, Hyperfunction, Heterogeneous Integration Pioneering Semiconductor Technology</p>